拼痕优化

1. 检查相机角度是否符合校准，荧光相机需要达到0.01，明场需要达到0.05
2. descript

拍摄过程中lower(向右拉扣除背景）与upper值(向左拉增强信号)进行调整，让系统更清晰识别到信号，如果样本本身auto后upper低于5000，则样本信号可能较弱，考虑优化染色条件

1. descript可以用option-switching中，通过勾选/取消勾选 Use overlap inpixels选择拼接模式，默认为15%的Width Overlap（%）.

Width/Height Overlap百分比可同时调整数值为10%-25%，pixels模式的话可以同时调整100-500

并调整其数值使效果最优化，同时可调整Min allow sitch scorce（推荐值0.7，可调0.01，0.25，0.5，0.9，1）优化拼接效果，并点击save，如需要将调整后拼接参数应用到当前已经拍摄完成的样本中，可以对已识别的样本区域，右键选择compute switch

descript

1. descript扫描时，可以选择fix focus points模式

5.根据样本情况选择是否开启阴影校正